

УДК 533.952

ЭВОЛЮЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ПЛАЗМЕННЫХ РАЗМЫКАТЕЛЯХ

К. В. Чубар, В. В. Яньков

На основе понятия о вмороженности магнитного поля в электронную жидкость проанализирована динамика магнитного поля в плазме размыкателей. Показано, что снос поля током приводит к диссипации первого вблизи электродов и на неоднородностях плазмы и, следовательно, к возрастанию на несколько порядков величины сопротивления без нарушения квазинейтральности. Сопровождающая этот процесс пространственная неоднородность распределения электронного тока и магнитного давления вызывает движение ионов, которое дополнительно понижает плотность плазмы и усугубляет эффект.

Проведено сравнение различных теорий с экспериментальными данными.

Введение

Эрозионные плазменные размыкатели позволили в последнее время укоротить фронты импульсов сильноточных генераторов приблизительно на порядок [¹⁻⁴], подняв тем самым напряжение, что сразу привлекло внимание к ним и в первую очередь к применению их в задачах инерциального УТС. Столь значительный прогресс был достигнут без выяснения деталей работы размыкателей, поскольку в большинстве экспериментов измерялись фактически лишь вольт-амперные характеристики. До сих пор экспериментально не показано, где, собственно, происходит размыкание — на катоде, аноде, вдали от электродов, или надо говорить о внешнем и внутреннем электродах, или о направлении инжекции плазмы. В таких условиях единственной общепринятой причиной возрастания сопротивления плазмы («размыкания») следует считать уменьшение плотности плазмы, но и это не подтверждено прямыми измерениями. В вопросе о причинах уменьшения плотности плазмы единства нет. Наибольшую известность получила точка зрения авторов работы [¹] (см. также обзор [⁵]). Согласно ей, уменьшение плотности плазмы (эрозия) связано с уходом ионов на катод под действием электрического поля, магнитное же поле играет вспомогательную роль, обеспечивая магнитную изоляцию возникшего вакуумного промежутка. Такая картина хотя и допустима, но, на наш взгляд, мало обоснована. В диодных промежутках большинства установок отношение магнитного давления к электрическому B^2/E^2 составляет (после усреднения по объему) 10^1-10^6 (к исключениям относится установка [³], имеющая и другие конструктивные отличия). Это значит, что на плазму действуют в основном магнитные, а не электрические силы, и именно роль первых из них будет рассмотрена в нашей работе.

Практически во всех установках скорость тока превышает альфеновскую скорость, поэтому эволюция магнитного поля в размыкателях связана в основном со сносом его током, а не с движением ионов [^{6, 7}]. Этот эффект приводит к появлению диссипации магнитного поля даже в идеально проводящей плазме, обеспечивая сопротивление размыкателя, достаточное для объяснения экспериментальных данных без привлечения гипотезы о нарушении квазинейтральности и образования вакуумного промежутка. Сопротивление размыкателей рассматривается в разделе 1, где показано, что оно растет с уменьшением концентрации плазмы.

В разделе 2 показано, что снос магнитного поля током приводит к появлению магнитного давления, отрывающего плазму от электродов (в первую очередь от анода), что также ведет к росту ее сопротивления.

В разделе 3 проводится сравнение теоретических моделей и экспериментальных результатов.

Всюду рассматривается характерная для размыкателей двумерная ситуация с одной ненулевой компонентой магнитного поля (B_ϕ в цилиндрической и B_z в плоской геометриях) и $(\mathbf{B} \nabla) = 0$.

1. Сопротивление плазмы, вызванное сносом магнитного поля током

Оценим сопротивление размыкателя, электроды которого имеют форму коаксиальных цилиндров с радиусом порядка R , а замыкающая их плазма представляет собой шайбу толщиной L с концентрацией n . Тогда поток магнитной энергии, идущий от катода к аноду, равен

$$W = \frac{B^2}{8\pi} v_e 2\pi R L, \quad v_e = \frac{I}{ne2\pi RL}. \quad (1)$$

После подстановки v_e получаем, что этот поток не зависит от величины зазора и толщины плазменной шайбы. Особенно просто выглядит формула для связанного с этим потоком сопротивления

$$\tilde{R} = W/I^2 = 30 \frac{u}{c} [\Omega]. \quad (2)$$

Здесь c — скорость света, $u = I/ne2\pi R^2$ — скорость тока, усредненная по области масштаба R . При выводе учитывалось, что $B = 2I/cR$. Согласно (2), сопротивление растет с уменьшением n ($u \propto n^{-1}$).

Оценки такого типа уже использовались ранее, например, в теории z -пинчей [6]. Придадим им более конкретный смысл для частных моделей, воспользовавшись следующей системой уравнений [6, 7] (движением ионов пренебрегаем):

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{j}}{c} + \frac{1}{nec} [\mathbf{j}, \mathbf{B}],$$

$$\mathbf{j} = \frac{c}{4\pi} \operatorname{rot} \mathbf{B},$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -c \operatorname{rot} \mathbf{E}. \quad (3)$$

Рассмотрим сначала втекание электронов в идеально проводящий анод (или вытекание их из катода) из однородной ($n = \text{const}$) плазмы с высокой проводимостью ($\omega_{Be}\tau_e \gg 1$, $\tau_e = \sigma t / ne^2$ — время передачи импульса от электронов к ионам). Из формулы (1) легко видеть, что условиям сохранения переносимой магнитной энергии на границе плазма—электрод удовлетворить нельзя вследствие различия значений W из-за различия в концентрациях электронов. Следовательно, энергия должна диссирировать. Изучим механизм такой диссипации.

Из равенства нулю касательной к электроду компоненты электрического поля и из первого уравнения (3) следует, что

$$\frac{j_\perp B}{nec} = \frac{j_\parallel}{c},$$

т. е. электроны втекают в анод (или вытекают из катода) почти по касательной под углом

$$\theta \sim \frac{j_\perp}{j_\parallel} = \frac{1}{\omega_{Be}\tau_e} \ll 1. \quad (4)$$

Резкое возрастание j (вследствие появления j_{\parallel}) вблизи электрода и обеспечивает конечность диссипации при сколь угодно высокой проводимости — ситуация здесь аналогична с диссипацией во фронте ударной волны в газодинамике, также следующей из законов сохранения. Разобранный эффект хорошо известен в полупроводниковой плазме, более того, в этой области найдено даже аналитическое решение задачи о распределении тока в среде, правда, в линейном случае большого внешнего поля B и плоской, а не цилиндрической геометрии [8, 9]. Как и следовало ожидать, вся диссипация происходит в слое толщиной $R/\omega_{Be}\tau_e$ у электрода.

В нашем нелинейном случае течения электронов в собственном поле найти распределение j гораздо сложнее, но понять картину поведения линий тока вблизи электродов можно, обратив задачу, т. е. определив форму электролов — эквипотенциалей по заданному распределению j . Пусть в плоской геометрии $\mathbf{j} = j(x) \mathbf{e}_y$, $\mathbf{B} = B(x) \mathbf{e}_z$. Тогда из первого уравнения (3) форма электролов есть

$$y = \frac{\sigma}{nec} \int B(x) dx, \quad (5)$$

т. е. при $j(x) = \text{const}$ они являются параболами $y \sim x^2$.

Наличие идеально проводящих электролов не единственная возможная причина диссипации магнитной энергии в плазме размыкателей. Такую же роль может сыграть неоднородность плазмы или цилиндричность задачи.

Дело в том, что, согласно (3), стационарное протекание тока $\{(\text{rot } \mathbf{E})=0\}$ при $\sigma \rightarrow \infty$ возможно лишь вдоль линий $nr^2 = \text{const}$ в цилиндрическом и $n = \text{const}$ в плоском случаях [6, 7, 10]. Далее для простоты мы всюду в этом разделе будем рассматривать плоскую геометрию с $\mathbf{j} \nabla n \neq 0$, т. е. с наличием непреодолимых (без учета конечной проводимости плазмы) препятствий для электронов. В этом случае из (3) следует

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{c}{8\pi e} \left[\nabla \frac{1}{n}, \nabla B^2 \right] + \frac{c^2}{4\pi c} \Delta \mathbf{B}. \quad (6)$$

Первый член в правой части (6) и описывает протекание стационарного тока вдоль линий $n = \text{const}$ при $\sigma = \infty$.

Пусть сначала профиль плотности плазмы монотонен. Для определенности положим $j \parallel \mathbf{e}_y$, $n = n(y)$. Тогда, если электроны при своем движении втекают в более плотные области ($j \nabla n < 0$), магнитное поле быстро проникает в плазму в виде волны с крутым передним фронтом [7]

$$B = \frac{B_0}{2} \left[1 - \operatorname{th} \frac{k B_0 \sigma}{4} \left(x - \frac{c^2 k B_0}{8\pi} t \right) \right],$$

$$k = \left| \frac{1}{ec} \frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{n} \right|. \quad (7)$$

После выхода этой волны к границе плазмы при $x = L$ устанавливается стационарный профиль

$$B = B_0 \operatorname{th} \frac{k \sigma B_0}{2} (x - L), \quad x < L.$$

В обратном случае $j \nabla n > 0$ магнитное поле запирается вблизи противоположной границы плазмы $x = 0$ [7]

$$B = \frac{B_0}{1 + \frac{\sigma k B_0}{2} x}, \quad x > 0,$$

не проникая в ее толщу.

В обоих случаях в стационарном токе течет не через всю плазму, а лишь через зону толщиной порядка $\left(\left| \frac{\partial}{\partial y} \ln n \right| \omega_{Be} \tau_e \right)^{-1}$, т. е. испытывает сопротивление, лишь геометрическими факторами отличающееся от (2). Заметим, что в характерной для размыкателей цилиндрической геометрии этот эффект существует и при $n = \text{const}$ ($\nabla n r^2 \neq 0$).

Пусть теперь n не является монотонной функцией координат, тогда в плазме наличествуют мелкомасштабные возмущения плотности. В этом случае ее сопротивление существенно зависит от наличия линий $n=\text{const}$, соединяющих электроды, ведь проводимость вдоль них велика. Действительно, при отсутствии таких путей и течений «напролом» через препятствия $n(r)$ ($n=n(y)$, j в среднем направлен по Oy) сопротивление замагниченному электронному току при $\omega_{Be}\tau_e \gg 1$ очень велико. Если $1/n = 1/n_0 (1 + \alpha \cos ky)$ (конкретизация, практически не сказывающаяся на ответе), то в стационаре, согласно (6), ток течет по змеевидным линиям

$$x \sim \frac{\omega_{Be}\tau_e}{k} \cos ky + \text{const}$$

и, как нетрудно подсчитать испытывает сопротивление в $(\omega_{Be}\tau_e)^2$ раз превышающее обычное. Интересна математическая аналогия задачи о динамике магнитного поля в неоднородной плазме с задачей о диффузии в среде при наличии конвективного переноса, описываемого первым членом в правой части (6). В разобранном примере она допускает точное решение, представляя магнитное поле в виде

$$B = B(x, t) + \tilde{B}(x, t) \sin ky.$$

Разделяя в (6) плавные и быстро осциллирующие в пространстве члены, при учете $\tilde{B} \ll B$, $\partial/\partial x \ll k$ получаем

$$\begin{aligned} \tilde{B} &= \frac{\alpha\omega}{2n_0eck} \frac{\partial}{\partial x} B^2, \\ \frac{\partial B}{\partial t} &= \frac{c^2}{4\pi\omega} \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\alpha\omega B}{n_0e} \right)^2 + 1 \right] \frac{\partial B}{\partial x}. \end{aligned} \quad (8)$$

Аналогичная задача (правда, для линейной конвекции) была решена в [11] в предположении, что линии $n=\text{const}$ (линии конвективного переноса) образуют регулярную квадратную сетку

$$\frac{1}{n} = \frac{1}{n_0} (1 + \alpha \cos ky \cos kx).$$

Ответ в наших терминах сводится к повышению коэффициента диффузии (сопротивления) всего лишь в $(\omega_{Be}\tau_e)^{1/2}$ раз. Причина достаточно проста: электроны растекаются по линиям сетки, соединяющим электроды и имеющим вследствие баланса сносового и диффузионного членов в (6) эффективную толщину порядка $(k^2\omega_{Be}\tau_e)^{-1/2}$. Этот случай подтверждает необходимость детального изучения топологии линий $n=\text{const}$.

К сожалению, в наиболее реалистическом варианте случайного профиля $n(x, y)$, для которого узлы пространственной сетки расщепляются и линии $n=\text{const}$ ведут себя весьма сложно и причудливо, решения найти не удается. Очень естественно выглядит гипотеза о повышении сопротивления в $(\omega_{Be}\tau_e)^\alpha$ раз, где $1/2 < \alpha < 2$. Можно предположить, что $\alpha=1$.

Таким образом, неоднородность плазмы малой концентрации может существенно понизить ее проводимость, причем величина последней при $\tau_e \rightarrow \infty$ может стремиться к нулю ($\alpha=1/2$), бесконечности ($\alpha=2$) или константе ($\alpha=1$) в зависимости от конкретного вида $n(x, y)$.

В заключение раздела можно отметить интересные геометрические эффекты различной функциональной зависимости сопротивления плазмы от ее размеров. Так, например формулы (8) справедливы лишь в случае достаточно большого поперечного размера плазмы $L_x \geq \omega_{Be}\tau_e/k$, когда токовая «змея», изгибаясь по x , не «чувствует» границ. В иной ситуации, растекаясь вдоль них, она начинает испытывать сопротивление $\sigma^{-1}\omega_{Be}\tau_e k L_y$ (не зависящее от L_x), а не следующее из (8) $\sigma^{-1}(\omega_{Be}\tau_e)^2 L_y L_x^{-1}$. Схожий эффект имеет место и при диссипации тока у электродов, когда расстояние между ними достаточно мало $L_y \leq L_x/\omega_{Be}\tau_e$.

2. Образование разрыва плазмы

Из разобранных в разделе 1 моделей следует сильно неоднородное протекание тока через плазму малой концентрации, когда токовая скорость превышает альфеновскую. Возникающее при этом перераспределение магнитного давления приводит в движение ионы, и, хотя это движение в силу своей относительной медленности не изменяет предыдущих результатов, вызываемое им уменьшение концентрации может повышать сопротивление размыкателя и даже (в случае нарушения квазинейтральности) приводит к истинному размыканию. Рассмотрим этот эффект подробнее.

Эффект увеличения плотности тока и его растекания вдоль электродов (4) должен вызывать, как нетрудно видеть, отрыв плазмы от анода и ее прижимание к катоду за счет силы $1/c$ [j, B]. Этот результат прямо противоположен результатам электростатической модели эрозии плазмы [1, 5]. Отметим, что в одножидкостной гидродинамике, пренебрегающей сносом магнитного поля током, электроды симметричны и такого эффекта нет, остается лишь гораздо более слабый эффект, связанный с цилиндричностью: вблизи внутреннего электрода магнитное давление повышенено ($B^2 \sim r^{-2}$).

Протекание стационарного тока вдоль линий $nr^2 = \text{const}$ ($n = \text{const}$ в плоском случае) приводит к тому, что магнитное давление становится функцией $B^2/8\pi = r^{-2}f(nr^2)$. Установление этой зависимости происходит за счет распространения волны типа (7) со скоростью, меняющейся вдоль фронта за счет изменения величины $\nabla 1/nr^2$. В результате появляется магнитная сила, направленная поперек линий $nr^2 = \text{const}$, стремящаяся разорвать плазму вдоль них. Подобный эффект вызывают и другие варианты протекания тока через неоднородную плазму, разобранные в разделе 1. К сожалению, о распределении концентрации плазмы в размыкителях нет экспериментальных данных, и зона пониженной плотности, из которой разовьется разрыв, может располагаться на любом электроде или в зазоре.

Существует также возможность теплового отрыва плазмы от электрода. При втекании электродов в анод и вытекании из катода неизбежно происходит нарушение вморможенности магнитного поля, сопровождающееся нагревом электронов, согласно оценкам (1), (2). Поскольку отвод тепловой энергии происходит с токовой скоростью, то тепловое давление оказывается порядка магнитного и способно привести к отрыву плазмы и от катода.

3. Сравнение с экспериментом

В этом разделе мы будем сравнивать между собой теории работы плазменных размыкателей, которые в той или иной мере учитывают влияние магнитных полей. К ним относятся ставшая уже классической эрозионная теория, теория обычного МГД выноса сгустка плазмы из межэлектродного зазора и теория, предлагаемая в настоящей работе. Как уже отмечалось выше, ввиду чрезвычайной скучности экспериментальных данных настоящего отбора теорий провести нельзя, так как качественный ход вольт-амперных характеристик и величина сопротивления «разомкнутого» размыкателя $R \approx 1 - 10^2$ Ом хорошо объясняются всеми тремя, равно как и любой другой теорией, например почему-то никем не исследованной теорией развития аномального сопротивления вследствие ионно-звуковой неустойчивости. Можно лишь говорить о непротиворечивости той или иной теории экспериментам. Для этой цели удобно выделить три группы измерений: данные о роли направления инжекции, закорачивающей электроды плазмы, о роли полярности электродов и данные о динамике магнитного поля в плазме.

Первая группа очень важна для проверки эрозионной теории. Согласно ей, для работы размыкателя необходимо обеспечить инжекцию плазмы от катода к аноду, причем ток размыкания пропорционален плотности тока инжекции плазмы $i = nv_{in}$ [1, 5]. Прямая проверка, однако, не подтвердила этого: изменение параметров размыкателя при резком уменьшении плотности плазмы (при неизменном i) в работе [12] заставило авторов сделать вывод об определяющей роли n , а не i . К этим же выводам приводит работа установки [3], где к моменту подключения генератора тока $i=0$, а размыкание происходит не сразу.

Ко второй группе относятся свидетельства об изменении работы размыкателей при изменении полярности электродов [1³]. Если эрозионная и вышеизложенная теории, естественно, чувствительны к замене анода на катод, то одножидкостная МГД теория совершенно к ней безразлична. В то же время нельзя отрицать возможность существенной роли МГД выноса плазмы для первоначального снижения n и перевода плазмы по этому параметру в область эрозионной или нашей теории.

Наибольший интерес для сравнения представляют собой немногочисленные измерения магнитных полей в плазме размыкателей. Они свидетельствуют о быстром проникновении магнитного поля в плазму примерно с токовой скоростью [2, 1³] (причем в работе [1³] картина напоминает распространение волн с крутым передним фронтом (7)), о резко неоднородном протекании тока через плазму [1², 1³] и о стремлении электронов течь вдоль электродов [2]. Все это отнюдь не противоречит нашей теории, изложенной в разделе 1, но грубость измерений вследствие малого количества зондов не позволяет исключить и последовательный отрыв плазмы от электродов (см. раздел 2), характерный и для эрозионной теории.

Некоторую дополнительную информацию могут дать результаты экспериментов на установках других типов. Так, например, в установке плазменный фокус был обнаружен электродный режим со скольжением тока по поверхности анода [1⁴], сопровождавшийся отрывом плазмы от него. В работе [1⁵] этот эффект объясняется сносом магнитного поля током. Отметим, что геометрия плазменного фокуса с выходом токовой оболочки на ось делает его очень эффективным размыкателем—обострителем, возрастание сопротивления перетяжки происходит за время, более чем в 10^3 раз меньшее по сравнению со временем нарастания тока (правда, переброса тока в другую цепь не происходит). Плазменный фокус отличается от плазменных размыкателей и геометрией и более высокой концентрацией плазмы, тем не менее наблюдаемый в нем отрыв плазмы от анода может происходить и в размыкателях. Согласно теории раздела 2, более низкая концентрация лишь способствует этому эффекту.

Возрастание сопротивления в прианодной части наблюдалось также в коаксиальных плазменных ускорителях, там это явление получило название анодного взрыва [1⁶].

В заключение можно сделать вывод о том, что вопрос окончательного выбора теории упирается в проведение дополнительных экспериментов с хорошими диагностиками, причем в первую очередь для определения профиля плотности плазмы и магнитного поля.

Литература

- [1] Ottinger P. F., Goldstein S. A., Meger R. A. J. Appl. Phys., 1984, v. 56, N 3, p. 774—784.
- [2] Weber B. V., Commissio R. J., Meger R. A. et al. Appl. Phys. Lett., 1984, v. 45, N 10, p. 1043—1045.
- [3] Долгачев Г. И., Закатов Л. П., Скорюшин В. А. Физика плазмы, 1987, т. 13, № 6, с. 760—763.
- [4] Абдуллин Э. Н., Батанов Г. П., Бастроиков А. Н. и др. Физика плазмы, 1985, т. 11, № 1, с. 109—110.
- [5] Иваненков Г. В. Препринт ФИАН, № 318. М., 1985. 42 с.
- [6] Чернов А. А., Яньков В. В. Физика плазмы, 1982, т. 8, № 5, с. 931—940.
- [7] Кинесен А. С., Мохов Ю. В., Чубар К. В. Физика плазмы, 1984, т. 10, № 4, с. 854.
- [8] Соколов Ю. Ф., Гастев В. В. ФТП, 1975, т. 9, с. 1694—1703.
- [9] Thomson A. H., Kino G. S. J. Appl. Phys., 1970, v. 41, N 6, p. 3064—3075.
- [10] Морозов А. И., Шубин А. П. ЖЭТФ, 1964, т. 46, № 2, с. 710—718.
- [11] Оsipенко М. В., Погуце О. П., Чудин Н. В. Физика плазмы, 1987, т. 13, № 8, с. 953.
- [12] Greenly J. B., Rondeau G. D., Sheldon H. T. et al. Proc. VI Intern. Conf. on High-Power Particle Beams. Kobe, 1986, p. 890—893.
- [13] Weber B. V., Colombar D. G., Commissio R. J. et al. Proc. VI Intern. Conf. on High-Power Particle Beams. Kobe, 1986, p. 882—885.
- [14] Базденков С. В., Гуреев К. Г., Филиппов Н. В., Филиппова Т. И. Письма в ЖЭТФ, 1973, т. 18, № 3, с. 199—201.
- [15] Вихрев В. В., Брагинский С. И. В сб.: Вопросы теории плазмы / Под ред. М. А. Леоновича. М.: Атомиздат, 1980, №, 10, с. 243—318.
- [16] Порошиков А. А., Петросов В. А., Острецов Н. Н. В сб.: Физика и применение плазменных ускорителей / Под ред. А. И. Морозова. Минск, 1971, с. 239—260.